

Nama : ASHI RAHMA TIKA

Npm : 2013023010

Kelas : 3B

Materi : Prinsip-Prinsip Kimia Anorganik

Judul Materi : Interaksi antar Partikel

Kelompok dan nama kelompok : kelompok 7

1. Zhilal ZhaFira

2. Nengan Anggi Puspita dewi

3. Elisabet eriana nadia putri

Kecenderungan titik leleh dan titik didih pada gas mulia dari atas ke bawah semakin bertambahnya nomor atom dan massa atom.

Proses terbentuknya interaksi antar atom pada gas mulia, yaitu berdasarkan elektron selalu bergerak disekitar inti atom, salah satu sisi molekul monoatomik dengan awan elektron semakin besar sehingga bermuatan parsial negatif dan sisi lain bermuatan parsial positif. Bentuk monoatomik biasanya disebut dipol seraat.

Berdasarkan teori pita

↳ celah pita (band gap) :

Jarak antara pita valensi dengan pita konduksi pada pita konduktor, semi konduktor dan isolator.

↳ Permukaan Fermi (Fermi level) :

Orbital molekul dengan tingkat energi tertinggi yang ditempati oleh elektron.

Kekuatan ikatan logam bergantung pada banyaknya elektron valensi yang terikat pada atom logam tersebut

Besar celah energi pada tiap tingkatan / tiap pita energi tidak sama besar, karena sifat konduktivitas dan konsentrasi ditentukan oleh faktor perbandingan celah energi dengan temperatur, ketiga perbandingan besar



maka konsentrasi sifat intrinsik akan rendah dan konduktivitasnya akan rendah

Pada ikatan hidrogen tidak termasuk gaya van der Waals karena ikatan hidrogen termasuk dalam interaksi dipol-dipol. Sehingga ikatan hidrogen merupakan salah satu gaya van der Waals, tetapi beberapa referensi ikatan hidrogen dianggap tidak termasuk gaya van der Waals karena kekuatan ikatan cenderung besar dan pada interaksi antar molekul lain.